

УДК 533.9

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ПЛОСКОСТЕЙ В ОБЛАКЕ ЭЛЕКТРОНОВ И В ПЛАЗМЕ

С. И. Яковленко

Рассмотрено распределение потенциала, напряженности поля и плотности плазмы в случае, когда заряженные плоскости окружены термоэмиссионными электронами, компенсирующими их заряд, или помещены в плазму конечной плотности. Показано, что плоскости, окруженные термоэмиссионными электронами (как и плоскости, помещенные в плазму) расталкиваются за счет электростатических сил. Получены выражения для электростатического давления.

1. *Введение.* При рассмотрении свойств термоэмиссионной пылевой плазмы [1] некоторый интерес представляет плоская модель пылевых частиц, поскольку для нее возможно общее решение уравнения Пуассона–Больцмана в квадратурах. Обычно (см., например, [2, 3]) рассматривают случай, когда положительные заряды в плазме полностью сосредоточены на пылинках, окруженных облаком термоэлектронов. Однако интерес представляет и ситуация, когда имеет место дополнительная ионизация газа, в котором находятся пылинки. Примером может служить как пылевая плазма в электрическом разряде, так и ядерно-возбуждаемая пылевая плазма [4, 5]. Рассмотрению взаимодействия плоскостей в этих случаях посвящена данная работа.

2. *Постановка задачи. Уравнение Пуассона–Больцмана.* Пусть электронный газ, окружающий заряженные частицы, формируется за счет эмиссии электронов из пылинок, имеющих достаточно высокую температуру T . Кроме того, пылинки находятся в частично ионизованном газе. Для нахождения распределения по пространству потенциала ϕ , напряженности поля $\mathbf{F} = -\nabla\phi$ и плотности заряда $\rho = e(N_i - N_e)$ следует решить уравнение Пуассона $\nabla^2\phi = 4\pi\rho$. В этом уравнении плотности ионов N_i и электронов N_e определяются распределением Больцмана $N_i = N_{i0} \exp(-e\phi/T)$, $N_e = N_{e0} \exp(e\phi/T)$,

где N_{i0} и N_{e0} – плотности ионов и электронов в тех точках, где потенциал равен нулю; ∇ – гамильтонов векторный оператор.

Итак, уравнение Пуассона–Больцмана имеет вид

$$\Delta\phi = 4\pi e(N_{e0} \exp(e\phi/T) - N_{i0} \exp(-e\phi/T)), \quad (1)$$

где $\Delta = \nabla^2$ – оператор Лапласа; температура частиц и плазмы считается одинаковой.

Безразмерные величины. Будем измерять длину в единицах $d = 8\pi e^2/T$. Введем безразмерные величины – потенциал φ , напряженность поля \mathbf{E} и плотность электронов n_e – с помощью соотношений:

$$\varphi = \phi e/T; \quad \mathbf{E} = \mathbf{F} e d/T; \quad n_e = (8\pi e^2/T)^3 N_e. \quad (2)$$

Для безразмерных величин, уравнение (1) сводится к следующему уравнению для безразмерного потенциала φ :

$$\Delta\varphi = (1/2)(\exp(\varphi) - \delta \exp(-\varphi)), \quad (3)$$

где $\delta = N_{i0}/N_{e0}$ – параметр, характеризующий дополнительную ионизацию газа. При этом $(\nabla\mathbf{E}) = -(1/2)(\exp(\varphi) - \delta \exp(-\varphi))$, $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$. В силу квазинейтральности плазмы: $0 \leq \delta \leq 1$.

В плоском случае уравнение (3) имеет вид

$$d^2\varphi/dx^2 = (1/2)(\exp(\varphi) - \delta \exp(-\varphi)), \quad E = -d\varphi/dx, \quad n_e = \exp(\varphi). \quad (4)$$

Здесь x – расстояние до заряженной плоскости.

Граничные условия. В качестве первого граничного условия естественно задавать плотность положительного заряда на заряженной поверхности σ . Этим задается значение напряженности поля на заряженной поверхности F_0 . Оно соответствует напряженности поля в плоском конденсаторе: $F_0 = 4\pi\sigma$, или $E_0 = \sigma d^2/2e$.

Второе граничное условие выберем в некоторой точке a_0 , соответствующей нулевой напряженности поля, где заряд поверхности полностью компенсируется зарядом слоя электронов: $E(a_0) = 0$.

3. Распределение поля и потенциала. Общее решение. Наиболее полное рассмотрение уравнения (4) для случая $\delta = 1$ дано в [6] в связи с теорией сильных электролитов, случай $\delta = 0$ рассмотрен в [3]. Начнем с рассмотрения общего случая.

Понизим порядок уравнения Пуассона–Больцмана, рассматривая напряженность поля, как функцию потенциала:

$$EdE/d\varphi = (1/2)(\exp(\varphi) - \delta \exp(-\varphi)).$$

Первое интегрирование дает связь напряженности поля с потенциалом:

$$E = (\exp(\varphi) + \delta \exp(-\varphi) - \exp(\varphi_1) - \delta \exp(-\varphi_1))^{1/2}. \quad (5a)$$

Здесь φ_1 – значение потенциала в точке a_0 , где напряженность поля равна нулю.

Второе интегрирование дает связь потенциала φ с координатой x :

$$x = \int_{\varphi}^{\varphi_0} \frac{dy}{\sqrt{\exp(y) + \delta \exp(-y) - \exp(\varphi_1) - \delta \exp(-\varphi_1)}}. \quad (5b)$$

Здесь $\varphi_0 = \varphi(0)$ – значение потенциала на заряженной плоскости. Оно связано с задаваемой на границе напряженностью поля E_0 соотношением (5а) при $\varphi = \varphi_0$. Связь φ_1 с φ_0 (и, соответственно, с E_0) следует из соотношения (5б). Она имеет вид $x(\varphi_1) = a_0$. Формулы (5) являются общим решением плоской задачи в квадратурах.

Уединенная заряженная плоскость. При рассмотрении уединенной плоскости ($a_0 \rightarrow \infty$) в полупространстве, где плотность положительных зарядов равна нулю ($\delta = 0$), когда термоэмиссионные электроны полностью экранируют положительный заряд плоскости, полагая в (5б) $\delta = 0$, $\varphi_1 = -\infty$, имеем в результате интегрирования:

$$\varphi(x) = 2 \ln[2E_0/(xE_0 + 2)]; \quad E(x) = 2E_0/(xE_0 + 2), \quad n_e(x) = [2E_0/(xE_0 + 2)]^2. \quad (6)$$

Рассмотрению уединенной заряженной плоскости ($a_0 \rightarrow \infty$) в полупространстве, заполненном плазмой, соответствует случай $\delta = 1$. Дело в том, что плотность положительных зарядов в плоском плазменном слое на единицу поверхности будет бесконечной для слоя бесконечной толщины (при конечной объемной плотности заряда). Соответственно, на бесконечно удаленном расстоянии можно пренебречь термоэмиссионными электронами. Полагая поле и потенциал на бесконечном расстоянии от заряженной плоскости равными нулю (соответственно, $\varphi_1 = 0$), проводя интегрирование и разрешая получившееся выражение относительно φ , приходим к известному результату (см., например, [6, 7]):

$$\varphi(x, \varphi_0) = 2 \ln \left(\frac{1 + \exp(-x) \cdot \tanh(\varphi_0/4)}{1 - \exp(-x) \cdot \tanh(\varphi_0/4)} \right),$$

$$E = 2 \cdot \text{sh}(\varphi/2), \quad n_e(x, \varphi_0) = \left(\frac{1 + \exp(-x) \cdot \tanh(\varphi_0/4)}{1 - \exp(-x) \cdot \tanh(\varphi_0/4)} \right)^2,$$

где $\varphi_0 = 2 \text{arcsch}(E_0/2)$.

Две заряженные плоскости. Между двумя заряженными плоскостями поле обращается в нуль при конечном значении $x(\varphi_1) = a_0$. В случае плоскостей с одинаковой поверхностной плотностью заряда, a_0 равно половине расстояния между плоскостями.

В случае $\delta = 0$ интегрирование уравнения (5б) дает

$$\varphi(x) = \ln(E^2 + E_1^2), \quad E(x) = E_1 \cdot \text{tg}[(a_0 - x)E_1/2], \quad n_e(x) = (E^2 + E_1^2). \quad (7)$$

Величина $E_1 \equiv \exp(\varphi_1/2)$ (и, соответственно, φ_1) связана с a_0 простым соотношением

$$a_0 = (2/E_1) \cdot \text{arctg}(E_0/E_1). \quad (8)$$

Для $\delta \neq 0$ связь φ_1 с задаваемыми величинами a_0 , φ_0 и δ определяется намного сложнее:

$$\begin{aligned} a_0 &= \int_{\varphi_1}^{\varphi_0} \frac{dy}{\sqrt{\exp(y) + \delta \exp(-y) - \exp(\varphi_1) - \delta \exp(-\varphi_1)}} = \\ &= \frac{1}{\delta^{1/4}} \int_{\varphi_1 + 2\ln(1/\delta)}^{\varphi_0 + 2\ln(1/\delta)} \frac{dy}{\sqrt{2(\text{ch}(y) - \text{ch}(\varphi_1 + 2\ln(1/\delta)))}} = \frac{1}{\delta^{1/4}} \int_{\varphi_1 + 2\ln(1/\delta)}^{\varphi_0 + 2\ln(1/\delta)} \frac{(1/2)dy}{\sqrt{\text{ch}^2(y/2) - \text{ch}^2(y_1/2)}} = \\ &= \frac{k}{\delta^{1/4}} \int_{u(\varphi_0 + 2\ln(1/\delta))}^{u(\varphi_1 + 2\ln(1/\delta))} \frac{dz}{\sqrt{(1 - z^2)(1 - k^2 z^2)}} = \frac{k}{\delta^{1/4}} F(k, u(\varphi_0 + 2\ln(1/\delta))). \end{aligned}$$

Или

$$a_0 = \delta^{-1/4} k \cdot F(k, u(\varphi_0 + 2\ln(1/\delta))), \quad (9)$$

где

$$u(\varphi) = 1/(k \cdot \text{ch}(\varphi)), \quad k = 1/\text{ch}(\varphi_1 + 2\ln(1/\delta)), \quad F(k, u) = \int_u^1 \frac{dz}{\sqrt{(1 - z^2)(1 - k^2 z^2)}}.$$

При этом неявная зависимость потенциала от координаты определяется выражением

$$x = a_0 - \delta^{-1/4} k \cdot F(k, u(\varphi + 2\ln(1/\delta))). \quad (10)$$

Интересен случай большого положительного потенциала $\varphi_0 \gg 1$. При $\varphi_0 \rightarrow \infty$ имеем [6]: $a_0 = \delta^{-1/4} k \cdot K(k)$, где $K(k) \equiv F(k, 0)$ – полный эллиптический интеграл.

Распределения потенциала для ситуации (см. рис. 1), когда две проводящие плоскости под одинаковым потенциалом $\varphi = \varphi_0$ находятся в электронном облаке, компенсирующем их заряд ($\delta = 0$), и в неограниченной плазме ($\delta = 1$) приведены на рис. 2, 3.

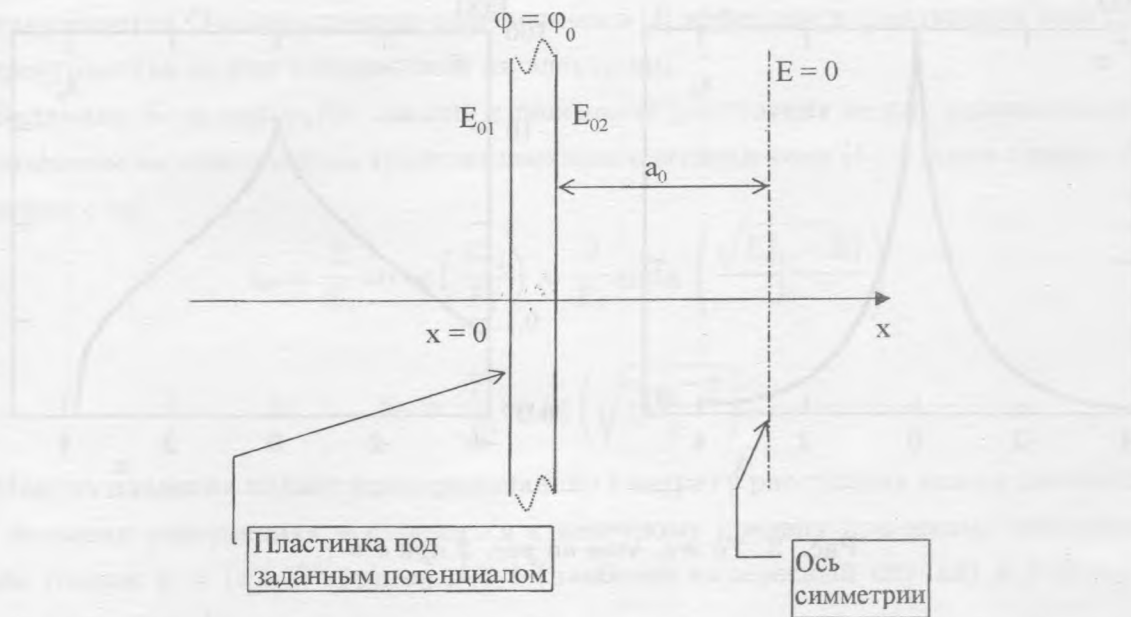


Рис. 1. Геометрия задачи о двух пластинах, окруженных облаком электронов или помещенных в плазму.

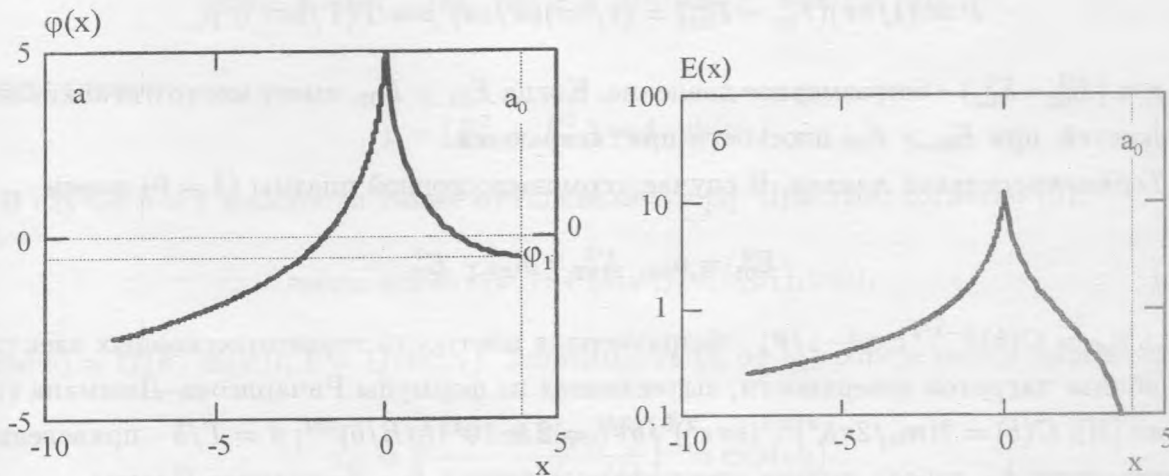


Рис. 2. Зависимость потенциала (а) и напряженности поля (б) от координаты в задаче о двух пластинах при $\delta = 0$, $a_0 = 4$, $\varphi_0 = 5$.

4. Расталкивание заряженных плоскостей. Электростатическое давление. Напряженность поля на поверхности плоскости слева, со стороны неограниченного полупро-

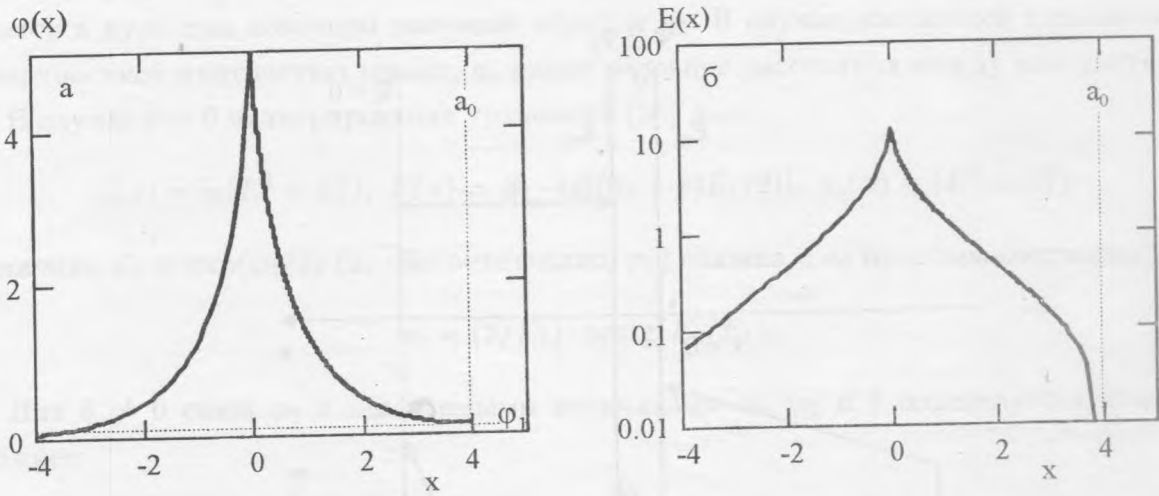


Рис. 3. То же, что на рис. 2 при $\delta = 1$.

странства $F_{01} = (T/ed) \cdot E_{01}$ и напряженность поля справа, со стороны, ограниченной другой плоскостью $F_{02} = (T/ed) \cdot E_{02}$ (рис. 1), отличаются. При этом возникает электростатическое давление на плоскость:

$$P = (1/8\pi)(F_{01}^2 - F_{02}^2) = (1/8\pi)(T/ed)^2 p = T(T/8\pi e^2)^3 p,$$

где $p = (E_{01}^2 - E_{02}^2)$ – безразмерное давление. Когда $E_{01} > E_{02}$, имеет место отталкивание плоскостей, при $E_{01} < E_{02}$ плоскости притягиваются.

Термоэмиссионная плазма. В случае термоэмиссионной плазмы ($\delta = 0$) имеем

$$E_{01}^2 = n_{e0}, \quad E_{02}^2 = n_{e0} - E_1^2.$$

Здесь $n_{e0} = C(b)\vartheta^{-3/2} \exp(-1/\vartheta)$ – безразмерная плотность термоэмиссионных электронов вблизи нагретой поверхности, вытекающая из формулы Ричардсона–Дешмана (см. также [3]); $C(b) = 2(m_e/2\pi\hbar^2)^{3/2}(8\pi e^2)^3/b^{3/2} = 2.9 \cdot 10^5 \cdot (\text{эВ}/b)^{3/2}$; $\vartheta = T/b$ – приведенная температура; b – работа выхода электронов со стенки, \hbar – постоянная Планка.

Соответственно, для безразмерного давления получаем

$$p = E_{01}^2 - E_{02}^2 = E_1^2 \geq 0.$$

Итак, сила электростатического давления, направленная в сторону неограниченного полупространства в рассматриваемой задаче всегда больше, чем сила, направленная

в сторону пространства, ограниченного другой плоскостью. Иначе говоря, плоскости расталкиваются. Это обусловлено отмеченным в [3] эффектом выдавливания электронов из пространства между плоскостями на электроды.

Величина $E_1 \equiv \exp(\varphi_1/2)$ связана с половиной расстояния между плоскостями a_0 и потенциалом на электроде φ_0 трансцендентным соотношением (6), откуда следует связь давления с a_0 :

$$a_0 = \frac{2}{E_1} \operatorname{arctg} \left(\frac{E_{02}}{E_1} \right) = \frac{2}{E_1} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{E_{01}^2 - E_1^2}}{E_1} \right)$$

или

$$a_0 = \frac{2}{\sqrt{p}} \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{n_{e0} - p}{p}} \right). \quad (11)$$

Модуль давления падает пропорционально квадрату расстояния между плоскостями при больших расстояниях и стремится к конечному пределу при малых расстояниях. Иначе говоря: $p = (\pi/a_0)^2$ при $a_0 \gg 1$ (наиболее интересный случай) и $p = n_{e0}$ при $a_0 \ll 1$ (см. рис. 4).

Заряженные плоскости в плазме. Рассмотрим ситуацию, когда плоскости находятся в неограниченной плазме ($\delta = 1$). Из (5а) имеем

$$E_{01}^2 = 4 \cdot \operatorname{sh}^2(\varphi_0/2), \quad E_{02}^2 = 4 \cdot (\operatorname{sh}^2(\varphi_0/2) - \operatorname{sh}^2(\varphi_1/2)),$$

откуда следует

$$p = (E_{01}^2 - E_{02}^2) = 4 \cdot \operatorname{ch}(\varphi_1). \quad (12)$$

В случае $\delta = 1$ плоскости также отталкиваются [6]. При этом согласно (9):

$$a_0(\varphi_0, \varphi_1) = k(\varphi_1) \cdot F(k(\varphi_1), u(k(\varphi_1), \varphi_0)), \quad (13)$$

где $u(\varphi) = 1/(k \cdot \operatorname{ch}(\varphi))$, $k = 1/\operatorname{ch}(\varphi_1)$. Зависимость φ_0 от n_{e0} определяется выражением

$$n_{e0} = \left(\frac{1 + \tanh(\varphi_0/4)}{1 - \tanh(\varphi_0/4)} \right)^2 = \exp(\varphi_0).$$

Соответственно, $\varphi_0 = \ln(n_{e0})$.

Выражения (11), (12) параметрически задают зависимость давления от расстояния между плоскостями и от n_{e0} (см. рис. 5).

5. Выводы. Итак, электростатическое взаимодействие между плоскостями, как окруженными облаком электронов, так и помещенными в плазму, приводит к расталкиванию

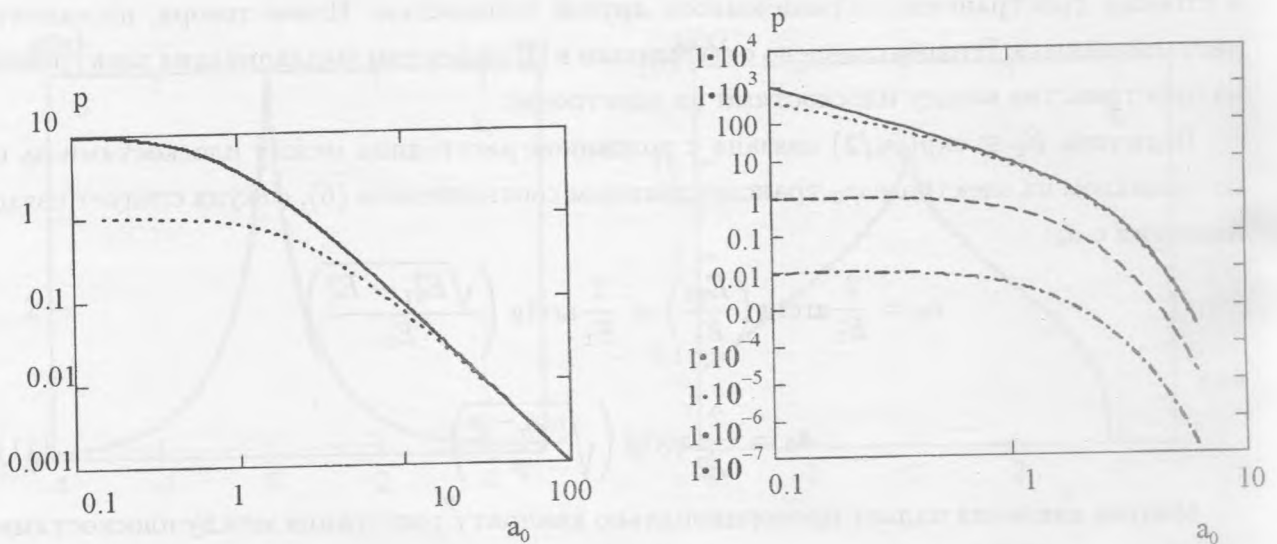


Рис. 4. Зависимость безразмерного электростатического давления p от половины расстояния между плоскостями a_0 при $\delta = 0$: $n_{e0} = 10$ – сплошная кривая, $n_{e0} = 1$ – пунктир.

Рис. 5. Зависимость электростатического давления p от половины расстояния между плоскостями a_0 при $\delta = 1$: $\varphi_0 \rightarrow \infty, n_{e0} \rightarrow \infty$ – сплошная кривая (вычислена с использованием предельного выражения $a_0 = k \cdot K(k)$, полученного в [6]); $\varphi_0 = 7, n_{e0} = 10^3$ – пунктир; $\varphi_0 = 1, n_{e0} = 2.7$ – штрихи; $\varphi_0 = 0.1, n_{e0} = 0.1$ – штрих-пунктир.

этих плоскостей. В то же время численные расчеты [8] показывают, что в случае сферических частиц имеет место притяжение. Возможно, это связано со следующими двумя обстоятельствами. Во-первых, в плоской задаче не учитывается перетекание электронов с периферии в центральную область на оси, соединяющей пылинки. Во-вторых, сила взаимодействия заряженных плоскостей (в отсутствие зарядов вокруг них) не зависит от расстояния между плоскостями, в то время как сила взаимодействия заряженных сфер обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Поэтому электроны, скопившиеся примерно на середине расстояния между пылинками, в случае взаимодействия сферических пылинок вносят больший вклад, чем в случае плоскостей. Тем не менее, вопрос о взаимодействии пылинок конечных размеров в облаке электронов и в плазме требует дополнительного исследования.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Фортвов В. Е., Нефедов А. П., Петров О. Ф. и др. ЖЭТФ, 111, N

- 2, 467 (1997).
- [2] Ткачев А. Н., Яковленко С. И. ЖТФ, **69**, N 1, 53 (1999).
 - [3] Яковленко С. И. Письма в ЖТФ, **26**, N 8, 47 (2000); Краткие сообщения по физике ФИАН, N 9, 10 (1999).
 - [4] Фортвов В. Е., Владимиров В. И., Депутатова Л. В. и др. ДАН, **336**, N 2, 184 (1999).
 - [5] Яковленко С. И. Краткие сообщения по физике ФИАН (направлено в печать).
 - [6] Derjagin В., Landau L. Acta Physicochimica U.R.S.S., **XIV**, No 6, p. 633.
 - [7] Сивухин Д. В. Вопросы теории плазмы. Вып. 4/ Под ред. М. А. Леонтовича. М., Госатомиздат, 1964, с. 81.
 - [8] Яковленко С. И. Письма в ЖТФ, **25**, N 16, 83 (1999); Краткие сообщения по физике ФИАН, N 9, 3 (1999).

Институт общей физики РАН

Поступила в редакцию 23 сентября 2000 г.